科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 29 年 6 月 1 0 日現在

機関番号: 13101
研究種目: 挑戦的萌芽研究
研究期間: 2014~2016
課題番号: 2 6 6 3 0 0 0 8
研究課題名(和文)カーボンナノチューブの秩序化したマイクロ紐構造を有する機能性組織の試作
研究課題名(英文)Experimental development of functional material with orderly string-like micro
四交代主 者
鳴海 敬倫(NARUMI, Takatsune)
新潟大字・目然科字糸・教授
研究者番号:2 0 1 4 3 7 5 3
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000円

研究成果の概要(和文):カーボンナノチューブ(CNT)分散系に往復せん断流れを印加した際に誘起形成され るヘリカルバンド(HB)と呼ばれる秩序化した紐状組織構造を制御する方法を開発した.その紐状構造を含む機 能性材料を試作し,その特徴と有効性を実験的に明らかにした.そして,形成される機能性材料の導電性の異方 性には,分散媒の粘度,CNTの体積分率,段階的なせん断印加の方法が影響し,HBの形成条件を調整することに より,より秩序性の高い紐状構造ができ,導電異方性の調整が可能であることを明らかにした.特に,高せん断 速度の流れを印加した後に低せん断速度の流れを印加する方法により,高い導電違法性の材料が製作可能である ことを解明した.

研究成果の概要(英文):We have developed new methods to control the flow induced orderly string-like structures (Helical Band; HB) in carbon nanotube (CNT) dispersions under alternating simple shear flows applied. Moreover, functional materials with the HB structures were experimentally produced and the properties and effectivities of the materials were examined. In particular, it was clarified that the anisotropic conductivity of the material was controlled with the viscosity of carrier liquids, volume fraction of the CNT or multistep shear application. Higher anisotropic properties in electric conductivity was obtained when the low shear rate flow was applied after high shear rate pre-flow.

研究分野: 工学, 流体工学, レオロジー

キーワード: カーボンナノチューブ ヘリカルバンド 流動誘起構造 機能性材料 複雑流体 構造制御 導電異方

1.研究開始当初の背景

近年,カーボンナノチューブ(CNT)は, 優れた機械的強度,熱伝導性,電気的特性な どを有していることから ,様々な製品への応 用が期待されている.例えば,母材に CNT を分散させることで、単体の材料より優れた 機械的・電気的特性を実現出来ることなどが 報告されている(1).このような複合材料とし て用いる場合の材料特性に大きく影響を及 ぼす因子の一つとして分散質の配向状態が 挙げられる . CNT 分散系においても配向状 態を制御することは、複合材料の諸特性を改 善するために重要である .配向状態の制御方 法の一つに流動場を用いる方法がある. Anson ら⁽²⁾は, CNT と樹脂の希薄分散系に おいて、流動を加えることにより紐状構造が 形成できることを,光学観察で確認した.こ の細状構造を Helical Band (HB)と称して いる.しかし,分散媒の粘度やHB形成時の 流動速度などの諸条件が、紐状構造形成にど のように影響しているか,また,形成された 複合材料の機能性への影響については明ら かになっていない.これらの点を明らかにし, さらに,HB構造の形成方法を調整すること により、より有効な機能性を持つ材料が開発 できる可能性がある.

2.研究の目的

本研究では新たなHB形成方法を開発し, より機能性の高い材料の開発を試みた.そし て,往復単純せん断流による HB 形成方法を 用い,HB構造の形成性を検証するとともに, 形成される機能性材料における特に導電異 方性の向上を目指した.本研究では,母材と してシリコンゴムなども利用した試作を試 みたが,そのためには基本的な HB の形成過 程とその機能性を明らかにする事が,不可欠 であることが判明したため,次の点に焦点を 当てた研究を展開した.まず,粘度の異なる 分散媒(樹脂)を用いることで,分散媒の粘 度の影響の解明を試みた また母材中の CNT 濃度を増加させても秩序性の高い HB が作製 できるような条件を検討した.具体的には, 予せん断後にせん断速度を変えた流れをか けたときの影響を検討し,それぞれの条件で の電気的特性を評価した、以上のような流動 条件の違いによる HB 構造への影響と複合材 料の導電性への影響を明らかにし,秩序性と

機能性の高い複合材料の作製のための基礎 的データを集積することを目的とした.

3.研究の方法

(1) 実験試料

本研究では、分散媒としてケミテック四国 株式会社製の紫外線硬化性樹脂ケミシール U-1430(300mPa·s(25))、U-401(20 mPa·s(25))の2種類を使用した.ここ では、粘度の高いU-1430をU_H、粘度の低 いU-401をU_Lと表記する、樹脂の体積抵抗 率はそれぞれ、2.0×10¹³ Ω·m、3.3×10¹³ Ω·mでありどちらも絶縁樹脂である.また、 分散質として昭和電工(株)製の気相法炭素 繊維 VGCF[®](繊維径 150nm、繊維長 10~20 μ m 本文中 CNT と表記)を使用した. CNT の体積分率は 0.10~0.30vol%の間で変 化させた.

(2)実験装置および実験方法

本研究で使用した往復せん断装置の概略 を図1に示す.試料を2枚のガラスプレート の間に挟み込み,下部プレートを固定し上部 プレートを移動させることで単純せん断を 試料に印加する.プレート間にはスペーサー としてステンレス球が挟まれており,この球 の直径が隙間 H となり,本実験では $H=300\mu m$ である.本実験では,上部プレー トを,まず一方向に7mm(ひずみ量 $\gamma=23.3$) または14mm(ひずみ量 $\gamma=46.6$)移動し,次 に同量反対方向に移動させた.これを繰り返 し,せん断流れ印加中の形成過程を,倒立型 顕微鏡で観察し,デジタルカメラで撮影した. また,せん断印加後,紫外線を照射し硬化さ せた後に,導電性の評価を行った.

(3) 導電性の評価方法

HB 構造の導電性を評価するために以下の 方法を用いた.本研究では,便宜上 HB の長 手方向と平行な方向を parallel 方向,直角な 方向を cross 方向と称す.シート状にできる HB 構造を含む組織の中央部分を 25×25mm 切り出し,その両端面に導電性エポキシ接着 剤を塗布する.HB 構造に対して,まず parallel 方向となる2辺の断面に導電性エポ キシ接着剤を塗布,硬化させ,デジタルマル チメータを用い,二辺間の抵抗値を測定する. cross 方向の測定では,parallel 方向測定時の



接着剤部を除去し、その後同様にして抵抗 値を測定した.なお、接着剤部を除去して いるため測定方向により電極間の距離が 異なるが、その影響を考慮するために体積 抵抗率 ρ で評価した. ρ の算出方法を式(1) に示す.

$$\rho = \mathbf{R} \cdot \frac{\mathbf{A}}{\mathbf{L}} \tag{1}$$

なお, R は電極間の電気抵抗値、A は電極 間の断面積(厚さ×高さ)、L は電極間の距 離である.

4.研究成果

(1)分散媒の粘度の影響

図 2, 図 3 に, 粘度の異なる CNT 体積分 率 0.10 vol%試料について, ひずみ量の違い により HB 構造の形成過程を示す.図 2 の低 粘度分散媒 ULでは,図 2 (b) γ =233 ですで に HB構造が形成されているように見られる のに対し,図 3 の高粘度分散媒 UHについて は,図 3 (b) γ =233 ではまだ形成が不十分 であるように見られる.このように低粘度分 散媒が急激に構造形成するのに対し,高粘度 分散媒ではゆっくりと形成されていくこと が分かった.また,図 2 (c) (d)では一 旦形成された HB がちぎれているような様子 が確認される.



(d) $\gamma = 1400$

図2 低粘度分散媒(U_L)での Helical Band 構造の発達過程 (2.0s⁻¹)



図3 高粘度分散媒(U_H)での Helical Band 構造 の発達過程(0.5s⁻¹)

図2,図3で示したようなHB構造を有す る複合材料の体積抵抗率ρを求めた結果を図 4,図5に示す.横軸は上部平板の往復運動 によって印加された全ひずみ量,縦軸は複合 材料の抵抗率 ρ である.図4は parallel 方向 (HB の長手方向)における抵抗率であり, 図 5 は cross 方向 (HB 長手方向に垂直な方 向)における抵抗率である.緑のプロットが 低粘度分散媒 ULの抵抗率,赤のプロットが 高粘度分散媒 UHの抵抗率である.エラーバ ーは複数の複合材料に関する最大と最小で 示したデータのばらつきを示している.また, 本実験で用いたデジタルマルチメータの測 定可能範囲を超えた場合の抵抗率を()と してプロットした.

図 4 の parallel 方向では,高粘度分散媒

U_Hにおいて, γ =0の場合に対して, γ =233 で抵抗値が 1/10程度になった後,ひずみ量を 大きくしてもほぼ一定の値をとる.それに対 して,低粘度分散媒 U_Lにおいては,ひずみ 量を大きくするにつれて徐々に抵抗率が大 きくなり,ひずみ量 1400以上ではすべての 複合材料が絶縁になる.これは図 2(c) (d) の画像で見られるように parallel 方向におい て HBの断絶が起こっているためと考えられ る.なお,ここでは省略するが,高粘度分散 媒 U_Hの γ =2333では,このような断絶が見 られないことを確認している.

図 5 の cross 方向では,高粘度分散媒 U_H において,ひずみ量が 1866 まで徐々に抵抗 率が大きくなり,ひずみ量 2100 以上ではす べての複合材料において絶縁性を示すのに 対し,低粘度分散媒 U_Lにおいては,ひずみ 量 466 以上で絶縁性となる.これは,図 2, 図 3 の画像から分かるように,低粘度分散媒 U_Lの方が,HB形成が早いためであると考え られる.

ここで,これらの現象と分散媒の粘度との 関連を考察する.まず,低粘度の分散媒の方 が HB の形成が早いのは,CNT の凝集は, 粘度が低い方が CNT の移動が容易であるこ とが要因であると考えられる.一方で,一旦 形成された HB の断絶が起きるのは,局所的 な HB の回転軸がぶれて,転がり方向がばら ばらになり,その不安定性が助長することに 起因すると考えられる.例えば,図2(d)で は HBが流動方向に対して垂直になっておら ず,斜めになっている部分が見られる.この 場合,分散媒の粘度が低いことは,そのぶれ



図 4 parallel 方向の抵抗率. ■ : 低粘度分 散媒 (U_L) and ●: 高粘度分散媒 (U_H)



図 5 Cross 方向の抵抗率. ■ : 低粘度分散媒 (U_L) and ●: 高粘度分散媒 (U_H)

を押さえる方向には働かず,不均一な回転運動を止められないことが考えられる.その結果,このぶれにより異なる方向に進んでしまった HBが,断絶を起こしていると考えられる.高粘度樹脂では粘性力が強い分,安定方向に働くことが考えられる.言い換えれば,HBの形成は渦度方向の回転力の強さに寄ると考えられ,粘度が高い場合は,回転力が強く,形成される HBの運動方向も安定させたためと考えられる.なお,本実験では往復流を用いているため,回転方向が変わる際に更に回転方向の不安定性を助長させる可能性もあると思われる.

これらの結果から分散媒の粘度は HB 構造 形成の様子を大きく変えるということが分 かる.分散媒の粘度を下げることは HB 構造 の早い形成に繋がるが, HB の挙動の不安定 さを増すこととなる.従って, HB 構造の形 成には,粘度,せん断速度,ひずみ量などの 諸条件において最適な値が存在していると 考えられる.

(2)予せん断を印加する方法

次に,予せん断を印加する方法による HB の形成とその電気的特性について検討した 結果を述べる.予せん断のせん断速度を $\dot{\gamma}_1$, 続けてかけるせん断速度を $\dot{\gamma}_2$ とする.せん断 速度一定の系と比較するために, $\dot{\gamma}_1$ を印加し たときのひずみ量と $\dot{\gamma}_2$ を印加したときのひ ずみ量を合わせた値を全ひずみ量とした.実 験は,せん断速度 $\dot{\gamma}_1$ でひずみ量466までせ ん断を加え,その後, $\dot{\gamma}_2$ でひずみ量1866ま でせん断をかけた.なお,実験は片道距離14 mmで行い,CNT体積分率0.30 vol%につい て検討した.CNT体積分率0.30 vol%は,一 定のせん断速度ではHBが形成されない体積 分率である.

図 6 は , $\dot{\gamma}_1$ =2.0 s⁻¹のせん断をひずみ量 466 まで印加し,その後, $\dot{\gamma}_2$ =1.0 s⁻¹のせん断を ひずみ量 1866 までかけた際の形成過程画像 である.つまり,図 6(a)~(b)は $\dot{\gamma}_1$ =2.0 s⁻¹の 範囲の画像であり,図 6(c)~(e)はその後, $\dot{\gamma}_2$ =1.0s⁻¹のせん断をかけている際の画像で ある.図 6(c)~(e)にかけて徐々に HB が形成 される様子が確認できる.



図 6 高粘度分散媒 U_H / CNT0.30 vol%分散 系, (a) ~ (b)2.0 s⁻¹, (b) ~ (e)1.0 s⁻¹のせん断速 度での形成画像

このように高いせん断速度をかけた後に、 低いせん断速度のせん断をかけた場合には、 HB が形成される結果となった.これは凝集 開始時のせん断速度によって,分散している CNT 凝集体の構造変化に与える影響が異な るためであると予想される. すなわち, 絡み 合って広く分散凝集した CNT 分散系にせん 断をかけ始める際には, せん断速度が高くな るほどに小さな CNT 凝集体となっていくと 考えられる .0.30 vol%のような比較的高濃度 の分散系では,はじめのせん断をかけない状 態では CNT 量の 多さから CNT 同士の 絡み合 いが強いと考えられる . 1.0 s⁻¹程度の低いせ ん断速度ではその絡み合いを断ち切ること ができず,大規模な絡み合いの状態のままだ が, 2.0 s⁻¹ や 4.0 s⁻¹といった高いせん断速 度では、初期のCNT同士の絡み合いを崩し、 細かな凝集体になることができたと考えら れる.このような細かな凝集体は,後の HB 構造形成において核のような働きをしたの ではないかと考えられる.先に述べたように 0.30 vol%のような比較的高濃度の系では CNT 同士の絡み合いが強く,一定の低いせん 断速度では HB を形成することができない. そこで,初期のせん断で CNT の細かな凝集 体を形成することで,二段階目のせん断では 形成された細かな凝集体を核としてHBを形 成するという効果があったのではないかと 考えられる.

続いて , 予せん断をかけることによって形 成された HB を有する複合材料の導電性の測 定結果を示す.図7はそれぞれの条件による parallel 方向の抵抗率を示している. 図中, 0.30 vol%のサンプルに対して、せん断を加え る前の状態の抵抗率を黒のプロットで,最初 から 1.0 s⁻¹の一定のせん断をひずみ量 1120 まで加えた際の抵抗率を赤のプロットで示 している.同じ体積分率で,最初にγ₁=2.0 s⁻¹ のせん断をひずみ量 466, その後γ₂=1.0 s⁻¹ のせん断をひずみ量 1120 まで加えた場合の 結果を青で, γ₁=4.0 s⁻¹のせん断をひずみ量 466,その後ÿ₂=1.0s⁻¹のせん断をひずみ量 1120 まで加えた結果を緑のプロットで示し ている.また,参照のために CNT0.10 vol% 分散系に 0.5 s⁻¹のせん断をひずみ量 1400 ま でかけた場合の値をオレンジの記号で示し ている.なお,0.30 vol%分散系において,ひ ずみ量を 1120 までとしたのは, ひずみの増 加による断絶の影響を考慮し , 最も HB 構造 が秩序的に形成されているひずみ量を選択 したためである.最初に高いせん断速度のせ ん断を加えた結果(青と緑)は,どちらも抵抗 率がせん断なしの場合とほぼ同じ値を示し, 0.10 vol%の材料と比較して 1/10 程度の値を 示している.つまり,0.30 vol%での HB を 有する複合材料の parallel 方向の抵抗率は, 0.10 vol%の複合材料と比較して,1桁程度の 低下が見られた.図8は同様の条件における cross 方向の抵抗率の結果である.プロット の区別については図7と同じである.最初に

高いせん断速度のせん断を加えた結果(青と 緑)は、どちらもすべてのケースで絶縁性を示 している.このように、CNT量を0.30 vol% の比較的高濃度にして、せん断印加方法を工 夫して形成した材料は、cross 方向の絶縁性 を保ちつつ、parallel方向の抵抗率を1/10程 度に下げることができた.また、図9はHB 一本の導電性を測定した結果である.プロッ トの色については図7、図8と同様であり、 縦軸は長さ当たりの抵抗値である.HB 一本 の抵抗値に関しても、図7の parallel方向の 抵抗率と同様、予せん断をかけた0.30 vol% の場合は、0.10 vol%の場合よりも一桁程度低 い値を得ることができた.すなわち、10 倍程 度高い導電性を得ることができている.

以上の結果より,高濃度 CNT 分散系にお いて,高いせん断速度で予せん断をかけるこ とにより,初めの CNT の分散状態が変化し,



図 7 予せん断を印加した条件に対する parallel 方向の抵抗率の比較



図 8 予せん断を印加した条件に対する cross 方向の抵抗率の比較



図 9 予せん断を印加した条件における HB 一本での抵抗値の比較

HB 構造を形成することができることが分かった.また,導電性においても cross 方向の 絶縁性を保ったまま,parallel 方向の導電性 を1桁程度向上させることができた.これら の結果から,初めの CNT の分散状態を調整 することでより高い CNT 体積分率でも HB が形成できる可能性はあると思われる.

(3)結論

本研究では、CNT分散系に往復せん断流を 印加したときに形成されるひも状構造(HB 構造)の形成過程や HB 構造を有する複合材 料の電気的特性が,流動条件によってどのよ うに変化するかを検討した.その結果,以下 の結論を得た.

分散媒の粘度によって,HB構造の形成の 早さ,また,HB構造の安定性が異なること を明らかにした.低粘度の分散媒では,HB 構造の形成は早いが,ひずみ量が増大するほ どに HB構造の断絶が発生しやすい.この HB構造変化が複合材料の導電性に影響する ことを明らかにした.

CNT 分散系は,高濃度になるほどに HB 構造になりにくい.すなわち,HB 構造が形 成されるせん断速度範囲がなくなってくる. 本研究では,以下のような条件でせん断を与 えることによって,今までは形成されなかっ た CNT 体積分率において,HB 構造を形成 させることができた.

・往復運動において,一往復にかかる距離を より長くすることによって,HBが形成され るCNT体積分率を増加させることができた. また,cross 方向において絶縁性になりやす くなることを明らかにした.

・与えるせん断を二段階にすることで高濃度 CNT 分散系においても HB 構造が形成でき ることが明らかになった.初めのせん断で比 較的高いせん断速度でせん断を与えること によって,一定のせん断速度では形成されな かった高濃度 CNT 分散系での HB 構造が形 成されることが明らかになった.また,その parallel 方向の抵抗率を従来の条件より一桁 程度低下することができた.

以上のように CNT による紐状構造は,流 動条件などの調整でき,上記の方法を用いる ことにより導通性の高い組織ができること が明らかになった.これらの基礎データを元 に,今後さらに秩序性を上げた構造を形成す る方法を開発することにより,より有用な機 能性材料が開発できることを明らかにした.

参考文献

(1)竹内健司,藤重雅嗣,野口徹,"ナノカー ボン材料とその応用",日本ゴム協会誌, 83,11(2010):347-353

(2)Anson W.K.Ma, Malcolm R.Macley, Sameer S.Rahatekar : "Experimental observation on the flow-induced assembly of Carbon nanotube suspensions to form helical bands" : Rheol.Acta, 46, 979-987, (2007)

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計 1件) 小林知紀,<u>鳴海敬倫</u>,牛田晃臣,萱場龍一, 往復単純せん断流による CNT 分散系のひも状 構造形成における諸条件の影響,日本機械学 会 2016 年度年次大会要旨集 査読無 No.16-1, S0510202, 2016, 1-2

〔学会発表〕(計 1件) 小林知紀,<u>鳴海敬倫</u>,牛田晃臣,萱場龍一, 往復単純せん断流による CNT 分散系のひも状 構造形成における諸条件の影響,日本機械学 会 2016 年度年次大会,九州大学伊都キャンパ ス(福岡県福岡市),2016.9.14

〔その他〕 ホームページ等 http://fluidlab.eng.niigata-u.ac.jp/ind ex.html

6.研究組織
(1)研究代表者
鳴海 敬倫(NARUMI, Takatsune)
新潟大学・自然科学系・教授
研究者番号: 20143753